

PVD

Physical Vapor Deposition

PVD（物理蒸着）とは、真空中で金属などを気化させて薄膜コーティングを行う手法です。弊社では「電子銃溶融型イオンプレーティング」、「アーク放電イオンプレーティング」、「マグネトロンスパッタリング」の3方式の設備を保有しており、耐摩耗性皮膜や合金皮膜を容易に加工することができます。密着性に優れた硬質膜の生成が可能のため、擦り傷や摩耗剥がれに強く、耐蝕性・耐候性にも優れています。加工品は球状から長尺物まで可能で、電気を通さない絶縁物にも加工実績があります。

装置種類	大型バッチ機		インライン機	小型バッチ機	小型バッチ機
成膜方式	マグネトロンスパッタリング	アーク放電イオンプレーティング	マグネトロンスパッタリング	マグネトロンスパッタリング	電子銃溶融型イオンプレーティング
加工可能サイズ [mm]	Φ200 × 900		720×600×30	160×300×30	Φ160 × 250
皮膜例 (金属種)	Ti	○	○	○	○
	TiN		○	○	○
	TiC		○	○	○
	TiCN		○	○	○
	Au	○			○
	Cr	○	○	○	○
	CrN	○	○	○	○
	CrCN		○	○	
	TiAl			○	○
	TiAlN			○	○
	TiO ₂	○	○	○	○
	Ag合金	○			
	真鍮	○			
Cu	○				

